

智慧財產及商業法院專利行政判決雙月刊 114 年 10 月號

目 錄

1141001 有關第 104200991N01 號「連續型同步鍍膜設備」新型專利舉發事件（111 年度行專訴字第 52 號）（判決日：112.6.08）.....	1
一、 案情簡介	1
（一）案件歷程.....	1
（二）系爭專利請求項 1 之內容.....	1
二、 主要爭點及分析檢討	2
（一）主要爭點.....	2
（二）智慧局見解.....	2
（三）法院判決見解.....	2
（四）分析檢討.....	3
三、 結論與建議	4
四、 附圖	5

1141001 有關第 104200991N01 號「連續型同步鍍膜設備」新型專利舉發事件（111 年度行專訴字第 52 號）（判決日：112.6.08）

爭議標的：證據是否足以證明不具進步性

相關法條：專利法(103.3.24 日施行)之專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項

【判決摘要】

由於證據 6 已揭示雙面覆膜設備包括依序設置的緩衝空間—沉積空間—緩衝空間，前述緩衝空間係用以使待鍍物於此處進行緩衝動作，待鍍物可由沉積冶具所裝載。又參酌為增加鍍膜厚度或提升鍍膜均勻度，而使待鍍物在前後緩衝區位移多次以反覆通過鍍膜區間，乃為系爭專利申請前之通常知識，故所屬技術領域中具有通常知識者，應可配合證據 6 之雙面覆膜設備而採用能於沉積空間及其前後的緩衝空間三者間來回移動的沉積冶具（使待鍍物停下並改變傳輸方向亦屬一種緩衝動作，可於緩衝空間為之），以調整待鍍物在製程腔體內的動作，例如使待鍍物來回地反覆通過沉積空間及其前後的緩衝空間。是以，系爭專利請求項 1 僅為證據 6 技術內容之簡單變更，且相較於證據 6 亦未產生無法預期之功效，則系爭專利請求項 1 應為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 6 之內容所能輕易完成，故證據 6 已足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

（一）案件歷程：

系爭專利「連續型同步鍍膜設備」申請日為 104 年 1 月 21 日，本局於 104 年 2 月 24 日處分核准專利。

（二）系爭專利請求項 1 之內容：

一種連續型同步鍍膜設備，包含：一個真空腔體，包括 $(n+1)$ 個緩衝區間，及 n 個鍍膜區間，該等緩衝區間與該等鍍膜區間是沿一排列方向依序輪流設置， $n \geq 2$ 且是正整數； n 個陰極濺鍍靶組合，分別對應設置在該 n 個鍍膜區間，每一陰極濺鍍靶組合具有至少一種靶材；多數個載具，分別載放一個待鍍物且分別能被控制地於該多數鍍膜區間和該多數緩衝區間移動，其中，每一載具於各

鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動；及一傳輸機構，設置於該真空腔體，且於該等緩衝區間、該等鍍膜區間連續地設置，用以傳輸該等載具進行各鍍膜程序。

二、 主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

證據 6 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二) 智慧局見解：

1. 證據 6 揭示一種覆(鍍)膜設備(參其圖 4~5)，包含一個腔體（製程腔體 4），包括(2+1)個緩衝區間（第一緩衝空間 41、第三緩衝空間 45 及第二緩衝空間 44）及 2 個鍍膜區間（第一沉積空間 42 及第二沉積空間 43），該等緩衝區間與該等鍍膜區間是沿一排列方向依序輪流設置，2 個陰極濺鍍靶組合且每一陰極濺鍍靶組合具有至少一種靶材（第五靶材 423 及第六靶材 433），多數個載具（裝載待鍍物之沉積冶具），分別載放一個待鍍物且分別能被控制地於該多數鍍膜區間和該多數緩衝區間移動，其中，每一載具於各鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間之間移動；以及一傳輸機構（輸送系統 7），設置於該腔體，且於該等緩衝區間、該等鍍膜區間連續地設置，用以傳輸該等載具進行各鍍膜程序。（對應於系爭專利請求項 1 中，n 等於 2 之情形）

2. 證據 6 與系爭專利請求項 1 之差特徵異主要在於：該證據未揭示系爭專利請求項 1 之「多數個載具，分別載放一個待鍍物且分別能被控制地於該多數鍍膜區間和該多數緩衝區間移動，其中，每一載具於各鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」。其他證據亦未揭示「能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」。且證據 6 教示之技術內容係待鍍物要依序通過各腔體，不可能輕易推知該「能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」之技術特徵。

(三) 法院判決見解：

1. 關於上述差異特徵：依證據 6 說明書[0043]段揭示待鍍物可於緩衝空間進行原處等待或者調整輸送系統之傳輸速度等緩衝動作，即已教示雙面覆膜設備並非以單向勻速輸送待鍍物為必要，且為增加鍍膜厚度或提升鍍膜均勻度等需求，使待鍍物反覆通過鍍膜區間，乃為鍍膜技術領域中易於思及的技術手

段。

2. 又依參加人另案申請之甲證 6 發明專利（專利證號 I513840）說明書之【先前技術】記載：「〔0002〕一般用以在待鍍物表面鍍覆多層膜的量產設備，多半是以一鍍膜生產線來完成。該鍍膜生產線是沿一排列方向依序配置有在同一真空腔體內的一前緩衝區間、多數個各含有不同靶材的鍍膜區間，及一個後緩衝區間…〔0003〕在量產過程中，為均勻地鍍製出該等多層膜，該等待鍍物於各鍍膜區間執行各鍍膜製程時需分別於各鍍膜區間的靶材下方位移多次」，可見參加人自承在甲證 6 發明專利申請（103 年 12 月 25 日）前，為使待鍍物均勻地鍍製出該等多層膜，於各鍍膜區間位移多次以反覆通過進行鍍膜，確為系爭專利申請前一般鍍膜量產設備領域中之通常知識。
3. 由於證據 6 已揭示其覆膜設備包括依序設置的緩衝空間—沉積空間—緩衝空間，前述緩衝空間係用以使待鍍物於此處進行緩衝動作，待鍍物可由沉積冶具所裝載。又參酌為增加鍍膜厚度或提升鍍膜均勻度，而使待鍍物在前後緩衝區位移多次以反覆通過鍍膜區間，乃為系爭專利申請前之通常知識，故所屬技術領域中具有通常知識者，應可配合證據 6 之覆膜設備而採用能於沉積空間及其前後的緩衝空間三者間來回移動的沉積冶具（使待鍍物停下並改變傳輸方向亦屬一種緩衝動作，可於緩衝空間為之），以調整待鍍物在製程腔體內的動作，例如使待鍍物來回地反覆通過沉積空間及其前後的緩衝空間。是以，系爭專利請求項 1 僅為證據 6 技術內容之簡單變更，且相較於證據 6 亦未產生無法預期之功效，則系爭專利請求項 1 應為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 6 之內容所能輕易完成，故證據 6 已足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四) 分析檢討：

1. 系爭專利與證據 6 主要差異在於，證據 6 未揭示或隱含系爭專利請求項 1 之「（每一載具能於）各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」，及依證據 6 教示之技術內容係待鍍物要依序通過各腔體，不可能從中獲得「每一載具…能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」之技術特徵。惟法院見解，證據 6 已教示覆膜設備不以單向勻速輸送待鍍物為必要，且為增加鍍膜厚度或提升鍍膜均勻度，使待鍍物反覆通過鍍膜區間，屬系爭專利申請前之通常知識，業如前述，則所屬技術領域中具有通常知識者，為提升鍍膜均勻度或使鍍膜具有所需厚度等需求，即可採用能於沉積空間及其前後的緩衝空間三者間來回移動的沉積冶具，以使沉

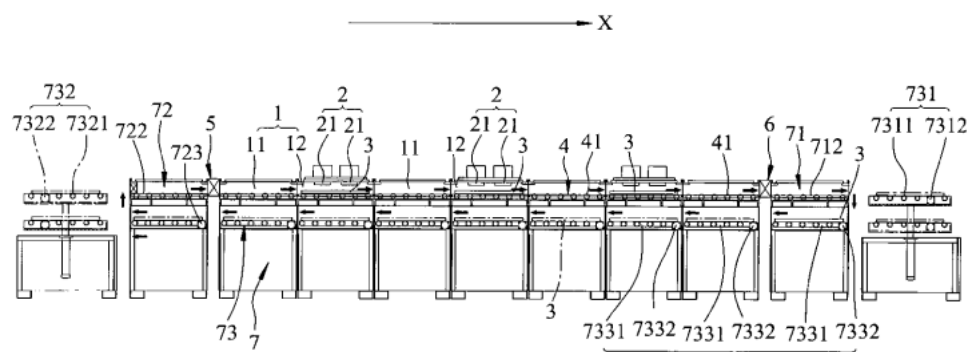
積冶金所承載之待鍍物可配合前述需求而在製程腔體內作動，例如反覆通過沉積空間進行鍍膜等。是以，系爭專利請求項 1 之「每一載具…能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」，應為所屬技術領域中具有通常知識者所能簡單變更而完成之技術特徵。

2. 甲證 6(於其【先前技術】欄位中)揭示在鍍膜量產過程中，為均勻地鍍製出該等多層膜，該等待鍍物於各鍍膜區間執行各鍍膜製程時需分別於各鍍膜區間的靶材下方位移多次，雖未明確指出如系爭專利請求項 1 所界定「能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」之技術特徵，惟依法院見解，該甲證 6 所揭露者仍足以佐證「為使待鍍物均勻地鍍製出該等多層膜，於各鍍膜區間位移多次以反覆通過進行鍍膜」等技術內容，確為系爭專利申請前一般鍍膜量產設備領域中之通常知識。

三、 結論與建議

- (一) 針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成系爭專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的「簡單變更」。雖於證據 6 並未揭露系爭專利請求項 1 之「每一載具…能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」，但法院見解其為所屬技術領域中具有通常知識者為增加鍍膜厚度或提升鍍膜均勻度等目的而會進行之簡單變更，故系爭專利請求項 1 應不具進步性。
- (二) (補強證據)甲證 6 發明專利申請日為 103 年 12 月 25 日，但其公開日為 105 年 7 月 1 日雖晚於系爭專利申請日，但由於甲證 6 亦為系爭專利之專利權人的專利案，在 103 年 12 月 25 日申請專利時，專利權人已自承說明書之【先前技術】，仍能做為系爭專利申請時之通常知識。甲證 6 雖僅揭示於各鍍膜區間的靶材下方位移多次，但法院見解其所揭露者仍足以佐證「於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」之技術內容為系爭專利申請前之通常知識，值得作為後續案件審查借鏡參考之用。

四、 附圖

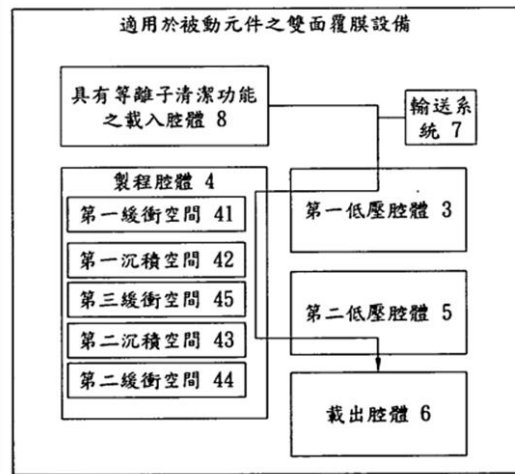


- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1 . . . 真空腔體 (製程腔體 4) | 5 . . . 入口閥門 |
| 11 . . . 緩衝區間 (緩衝空間 41、44、45) | 6 . . . 出口閥門 |
| 12 . . . 鍍膜區間 (沉積空間 42、43) | 7 . . . 自動回流單元 |
| 2 . . . 陰極濺鍍靶組 (靶材 423、433) | 71 . . . 載出腔 |
| 合 | 712 . . . 輸送組件 |
| 21 . . . 靶材 | 72 . . . 載入腔 |
| 3 . . . 載具 | 722 . . . 輸送組件 |
| 4 . . . 傳輸機構 (輸送系統 7) | |
| 41 . . . 輸送組件 | |

圖 1 系爭專利所請設備代表圖

(於請求項 1 所載元件後，以藍色字體表示其與證據 6 所對應者)

【證據 6 圖 4】



【證據 6 圖 5】

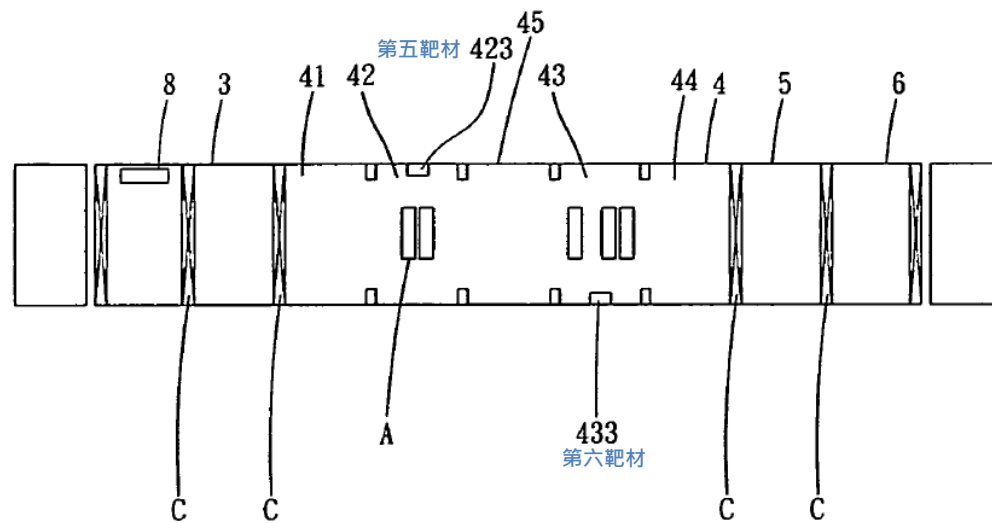
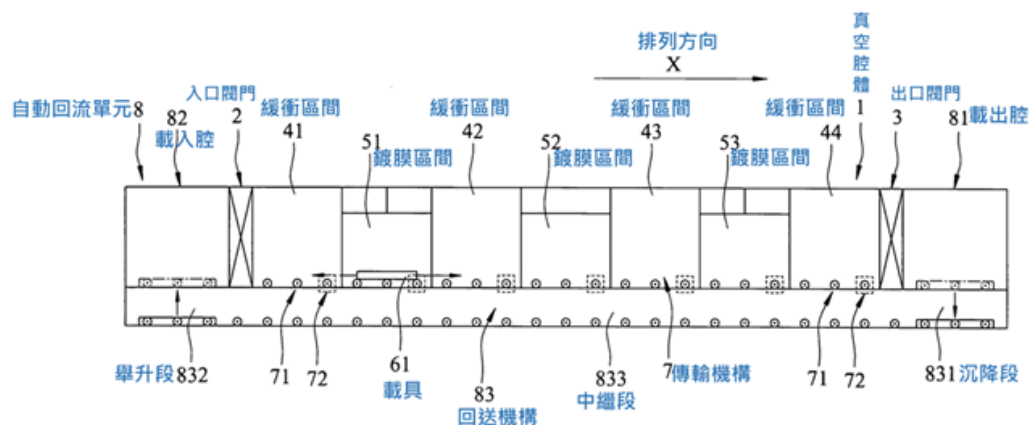


圖 2 證據 6 所揭示設備實施態樣示意圖
(對應於系爭專利請求項 1 中， n 等於 2 之情形)

【甲證 6 使用設備示意】



【先前技術】(佐證差異特徵為通常知識)

〔0002〕一般用以在待鍍物表面鍍覆多層膜的量產設備，多半是以一鍍膜生產線來完成。該鍍膜生產線是沿一排列方向依序配置有在同一真空腔體內的一前緩衝區間、多數個各含有不同靶材的鍍膜區間，及一個後緩衝區間…〔0003〕在量產過程中，為均勻地鍍製出該等多層膜，該等待鍍物於各鍍膜區間執行各鍍膜製程時需分別於各鍍膜區間的靶材下方位移多次…。

圖 3 甲證 6 之多層膜量產方法所使用設備示意圖/及(自承)先前技術